

800°C小型真空/气氛水平式区熔炉

OTF-1200-20-ZM

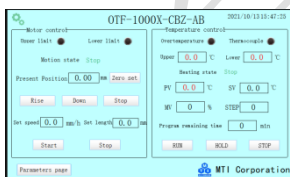




OTF-1200-20-ZM 是一款小型的水平式区熔炉，最高温度 800°C，加热区 6mm。设备配有炉管和密封法兰，可在真空或气氛保护环境下处理样品。此款设备适合各种材料的定向凝固、单晶生长和提纯。

技术参数

电源要求	<ul style="list-style-type: none"> • AC220V ± 10%，单相，50/60Hz • 功率：600W
加热模块	<ul style="list-style-type: none"> • 最高工作温度 800°C • 加热体内径：30mm

	<ul style="list-style-type: none"> • 加热区长度：6mm • 最大升温速率：10℃/min • 控温精度：±1℃ • 加热元件：硅钼棒 • 功率：200W
炉管和法兰	<ul style="list-style-type: none"> • 炉管为高纯石英管，尺寸 25 O.D(mm) x 19 I.D(mm) x 600 L (mm) • 配有一套不锈钢密封法兰： <ul style="list-style-type: none"> • 左法兰带有 1/4 英寸进气口及不锈钢截止阀和机械压力表，配有 KF25 快接口用于放置样品（图 1） • 右法兰带有 1/4 英寸出气口及不锈钢截止，配有 KF25 接口用于连接真空泵（图 2） <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>图 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>图 2</p> </div> </div>
区熔机构	<ul style="list-style-type: none"> • 通过精密伺服电机驱动加热炉体移动，对炉管内样品区熔 • 电机功率：400W • 移动行程：1mm-200mm • 移动速度：0.5-1000mm/h • 位移精度：1 微米 • 炉体可自动往复移动，最多循环次数：999
控制面板	<ul style="list-style-type: none"> • 触摸屏控制 • 可设置和显示参数：温度、位移、移动速度和往复循环次数
真空泵（标配中不包含）	<ul style="list-style-type: none"> • 选配机械泵，真空度可以达到 10⁻² torr • 选配分子泵系统，真空度可以达到 10⁻⁵ torr



	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 机械泵 分子泵 </div>
产品尺寸	850mm (L) *550mm (W) *750mm (H) 
产品质量	约 65kg
应用注意	为了对材料进行区熔，您可以在进行区熔之前，先通过 CIP 技术将粉末制成实心棒状样品，具体步骤如下所示。 